

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 11 月 20 日 (20.11.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/096395 A1

(51) 国際特許分類⁷: **H01L 21/02**, 21/68, F24F 7/06, 9/00

Tokyo (JP). 日本ケンブリッジフィルタ株式会社
(CAMBRIDGE FILTER JAPAN, LTD.) [JP/JP]; 〒105-
0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/10584

(22) 国際出願日: 2002 年 10 月 11 日 (11.10.2002)

(72) 発明者; および

(25) 国際出願の言語: 日本語

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木崎原 稔郎
(KISAKIBARU, Toshirou) [JP/JP]; 〒105-0001 東京都
港区虎ノ門2丁目10番1号 日本ケンブリッジフィ
ルター株式会社内 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-135222 2002 年 5 月 10 日 (10.05.2002) JP

(74) 代理人: 山崎 行造, 外(YAMASAKI, Yukuzo et al.); 〒
100-0014 東京都千代田区永田町一丁目11番28号
相互永田町ビルディング8階 山崎法律特許事務所
Tokyo (JP).

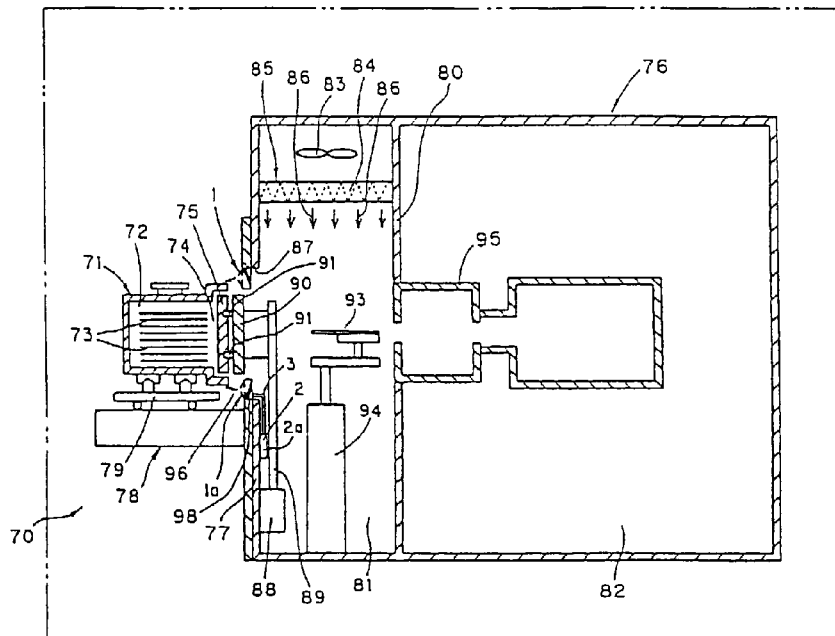
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 近藤工
業株式会社 (KONDOH INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP];
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS OF MINIENVIRONMENT SYSTEM

(54) 発明の名称: ミニエンバライメント方式の半導体製造装置



(57) Abstract: A semiconductor manufacturing apparatus (76) of minienvironment system for conveying a wafer (73) up to a semi-conductor manufacturing apparatus equipped with a wafer carry-in opening (98) with a wafer hermetic container (71). This apparatus comprises a clean air jet (1) which forms a clean-air curtain between the opening of the hermetic container and the wafer carry-in opening. The air curtain prevents outside air from flowing into an opening (74) when the hermetic container located in front of the wafer carry-in opening of the semiconductor manufacturing apparatus is opened.

(57) 要約: ウェハ搬入開口部 (98) を備える半導体製造装置に至るまでのウェハ (73) の搬送をウェハ密閉容器 (71) により行うミニエンバライメント方式の半導体製造装置 (76) であって、

[続葉有]



WO 03/096395 A1



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 国際調査報告書

半導体製造装置の上記ウェハ搬入開口部の前に位置する上記密閉容器が開かれたときに該密閉容器の開かれた開口部（74）に外部空気が流入することを防止する清浄空気のエアカーテンを上記密閉容器開口部と上記ウェハ搬入開口部の間に形成する清浄空気噴出装置（1）を備える半導体製造装置。